บรรณานุกรม

จินดาวรรณ ธรรมปรีชา. (2554). *โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และธนัสถา รัตนะ. (2547). การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. *รายงานการวิจัยประจำปี 2547. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม* (หน้า 163-166). กรุงเทพฯ: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

มติ ห่อประทุม. (2548). *การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคทีพ แมกนีตรอน สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

อดิศร บูรณวงศ์. (2551). *สภาพชอบน้ำของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี สปัตเตอริง*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Bunshah, R. F. (1994). *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings* (2nd ed.). New Jersey: Noyes.

Buranawong, A., Witit-anun, N., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A., & Limsuwan, L. (2011). The Effect of Titanium Current on Structure and Hardness of Aluminium Titanium Nitride Deposited by Reactive Unbalanced Magnetron Co-Sputtering. *Thin Solid Films, 519,* 4963-4968.

Burakowski, T., & Wierzchon, T. (1998). *Surface Energineering Metals: Principles, Equipment, Technologies.* Florida: CRC Press. 70.

Chapman, B. (1980). *Glow Discharge Processes*. New York: John Wiley & Sons.

Donohue, L.A., Cawley, J., & Brook, J.S. (1995). Deposition and Characterisation of Arc-Bond Sputter Ti_xZr_yN Coatings from Pure Metallic and Segmented Targets. *Surface and Coatings Technology, 72*, 128-138.

Hodak, S.K., Seppänen, T., & Tungasmita, S. (2008). Growth of (Zr,Ti)N Thin films by Ion-Assisted Dual D.C. Reactive Magnetron Sputtering. *Solid State Phenomena, 136,* 133-138.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Kim, D. J., Hahn, S. H., Oh, S. H., & Kim, E. J. (2002). Influence of Calcinations Temperature on Structural and Optical Properties of TiO_2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Dip Coating. *Materials Letters, 57*, 355-360.

Lin, Y.W., Huang, J.H., & Yu, G.P. (2010). Effect of Nitrogen Flow Rate on Properties of Nanostructured TiZrN Thin Films Produced by Radio Frequency Magnetron Sputtering. *Thin Solid Films, 518,* 7308-7311.

Liua, C., Leylanda, A., Lyonb, S., & Matthewa, A. (1995). Electrochemical Impedance Spectroscopy of PVD-TiN Coatings on Mild Steel and AISI316 Substrates. *Surface and Coatings Technology, 76-77*, 615-622.

Lugscheider, E., Knotek, O., Barimani, C., Leyendecker, T., Lemmer, O., & Wenke, R. (1999). PVD Hard Coated Reamers in Lubricant-Free Cutting. *Surface and Coatings Technology, 112*, 146-151.

Maissel, L. I., & Glang, R. (1970). *Handbook of Thin Film Technology*. New York: Mc Graw- Hill Book.

Munz, W. D. (1991). The Unbalanced Magnetron : Current Status of Development. *Surface and Coatings Technology, 48*, 81-94.

Niu, E.W., Li, L., Lv, G.H., Chen, H., Feng, W.R., & Yang, S.Z. (2008). Characterization of Ti–Zr–N Films Deposited by Cathodic Vacuum Arc with Different Substrate Bias. *Applied Surface Science, 254*, 3909-3914.

Purushotham, K.P., Ward, L.P., Narelle, B., Pigram, P.J., Peter, E., Hans, N., & Noorman, R.R. (2003). Tribological Studies of Zr-Implanted PVD TiN Coatings Deposited on Stainless Steel Substrates. *Wear, 254,* 589-596.

Ramana, J.V., Kumar, S., David, C., & Saju, V.S. (2004). Structure, Composition and Microhardness of (Ti,Zr)N and (Ti,Al)N Coatings Prepared by DC Magnetron Sputtering. *Materials. Letters, 58*, 2553-2558.

Rickerby, D. S., & Matthews, I. (1991). *Advanced Surface Coating: a Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

Rohde, S. L., & Munz, W. D. (1991). *Sputter Depostion in Advanced Surface Coatings: A Handbook of Surface Engineering*. New York: Chapman and Hall.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University

Smith, D. L. (1995). *Thin-Film Deposition : Principle And Practice.* New York: McGraw-Hill.

Sproul, W. D. (1992). Unbalanced Magnetron Sputtering. 35th Annual Technical Conference Proceedings. *Society of Vacuum Coaters*, 236-239.

Takeyama, M. B., Itoi, T., Ayogi, E., & Noya, A. (2003). Diffusion Barrier Properties of Nano-Crystalline TiZrN Films in Cu/Si Contact Systems. *Applied Surface Science, 216,* 181-186.

Uglov, V.V., Anishchik, V.M., Zlotski, S.V., & Abadias, G. (2006). The Phase Composition and Stress Development in Ternary Ti–Zr–N Coatings Grown by Vacuum Arc with Combining of Plasma Flows. *Surface and Coatings Technology, 200*, 6389-6394.

Uglov, V.V., Anishchik, V.M., Zlotski, S.V., Abadias, G., & Dub, S.N. (2008). Structural and Mechanical Stability Upon Annealing of Arc-Deposited Ti–Zr–N Coatings. *Surface and Coatings Technology, 202*, 2394-2398.

Vossen, J. L., & Kerns, W. (1978). *Thin Films Processes.* New York: Academic Press.

Wang, D.Y., Chang, C.L., Hsu, C.H., & Lin, H.N. (2000). Synthesis of (Ti, Zr)N Hard Coatings by Unbalanced Magnetron Sputtering. *Surface and Coatings Technology, 130*, 64-68.

Wasa, K., & Hayakawa, S. (1992). *Handbook of sputter deposition technology: principles technology and applications.* New Jersey: Noyes.

มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University